



(19)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 918 043 B8

(12)

KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

Hinweis: Bibliographie entspricht dem neuesten Stand

(15) Korrekturinformation:

Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)
INID code(s) 73

(51) Int Cl.7: C03C 17/245, C23C 14/08,

C23C 14/34

(48) Corrigendum ausgegeben am:

23.11.2005 Patentblatt 2005/47

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des

Hinweises auf die Patenterteilung:

14.09.2005 Patentblatt 2005/37

(21) Anmeldenummer: 98121350.7

(22) Anmeldetag: 10.11.1998

(54) Mit mindestens einer MgO-Schicht beschichtetes Substrat

Substrate coated with at least one MgO-layer

Substrat revêtu d'au moins une couche de MgO

(84) Benannte Vertragsstaaten:

DE FR NL

(30) Priorität: 20.11.1997 EP 97120354

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:

26.05.1999 Patentblatt 1999/21

(73) Patentinhaber: Applied Films GmbH & Co. KG
63755 Alzenau (DE)

(72) Erfinder:

- Stollenwerk, Johannes
63571 Gelnhausen (DE)
- Daube, Christoph
63755 Alzenau (DE)
- Guerke, Achim
63739 Aschaffenburg (DE)

(74) Vertreter: Troesch Scheidegger Werner AG

Patentanwälte

Postfach

8032 Zürich (CH)

(56) Entgegenhaltungen:

EP-A- 0 570 182

EP-A- 0 803 587

- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 562 (C-665), 13. Dezember 1989 & JP 01 234398 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), 19. September 1989
- YASUHISA KANEKO ET AL: "PREPARATION OF MGO THIN FILMS BY RF MAGNETRON SPUTTERING" JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, Bd. 30, Nr. 5, 1. Mai 1991, Seiten 1091-1092, XP000263714
- BRULEY J ET AL: "NANOSTRUCTURE AND CHEMISTRY OF A (100)MGO/(100)GAAS INTERFACE" APPLIED PHYSICS LETTERS, Bd. 65, Nr. 5, 1. August 1994, Seiten 564-566, XP000464872
- TSUGUO ISHIHARA ET AL: "STRUCTURE OF MGO FILMS PREPARED BY ION BEAM SPUTTERING" JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN, INTERNATIONAL EDITION, Bd. 97, Nr. 8, 1. August 1989, Seiten 4-10, XP000083701